## 經濟部智慧財產局專利核駁審定書

訂

受 文 者:日本電氣股份有限公司(代理人:周良

地 址:新竹市東大路一段一一八號十樓

發文字號:〈九〇〉智專二(一)04048字發文日期:中華民國九十年十二月三日

二、發明名稱:半導體裝置及其製造方法一、申請案號數:〇八九一二四一二六

三、申請人:

名稱:日本電氣股份有限公司

地址:日本

四、專利代理人:

姓名:周良謀 先生

地址:新竹市東大路一段一一八號十樓

、申請日期:八十九年十一月十四日

五

六、優先權項目:

1 1999/11/16 日本11-325770

專利分類第七版:H01L 23/12

第一頁

查委員姓 名: 王 一榮華 委員

定 內容:

主 文: 本業應 不予專 利

依 據 專 利法第二十條第二項

由:

本案之技術特徵有二:(1)利 用絕 緣 緩 衝 樹脂包覆導電凸塊 以 减 低應力;(2)絕緣 應力

惟利用特徵(1)以 緩 衝 樹 脂 層可形成於半導體基 減 低應力 ,實屬習知 板 表 面 , 技術 使 半 導 如一 體晶 片製造 九九九年一月二十二日公告之JP 步驟 以 晶圓 為單位得以 實現

017044, 其亦係 單位 而 從一 個 晶 利 用絕緣緩 圓 的 分割獲得大量的半導體晶片IC之技術特徵 衝樹脂包覆導電凸塊以減 低應 力) 。至於製造步驟 ,則已揭 ,示於一 以 九九九 晶圓為

年二月二日公告之美國專利第5866949號(附件二) 。因此,本案所有關 為熟知此技藝者可輕易完成 鍵技 術特 徴均

其產生功效, 亦 囿 於可預期之範圍 ,本案不具進步性

一接參考引證案而得之,本案所請係結合引證案技

術

而

據 上 不 論 服 本審 結,本案不符法定專利要件 定 , 得 於 文到 之次 日起三十日內 ,爰依專利法第二十條第二 備具再審查理由 項 書一式二份及規費新台幣參仟 審定 如主 文

百 元 整 向本局申請再審查



局長陳

投權單位主管決行依照分層負責規定

那